# 嵌入单量子点 Aharonov-Bohm 环中的近藤效应\*

吴绍 $2^{1}$ <sup>\*</sup> 孙威 $2^{1}$ <sup>\*</sup> 余万 $2^{2}$ <sup>\*</sup> 王顺 $2^{3}$ <sup>\*</sup>

<sup>1</sup>(四川师范大学物理系,成都 610068) <sup>2</sup>(成都信息工程学院,成都 610030) <sup>3</sup>(四川大学物理系,成都 610034) (2004年8月6日收到,2004年11月8日收到修改稿)

使用单杂质的 Ansderson 模型,从理论上研究了一个嵌入单量子点 Aharonov-Bohm 环系统处在近藤区时的基态 性质,并用 slave-boson 平均场方法求解了该模型.结果表明:在零温,当介观环内电子平均能级间隔大于近藤关联 能时,系统内仍然存在一个被减弱了的近藤效应;系统的基态性质依赖于系统的宇称和环的大小;而尺寸效应和 近藤屏蔽效应的共存导致了系统丰富的物理性质.同时,可以通过测量介观环中的持续电流和杂质磁化率,达到 探测近藤屏蔽云的目的.

关键词:持续电流,杂质磁化率,宇称效应,近藤效应,近藤屏蔽云 PACC:7335,7335C,7215Q

### 1.引 言

纳米技术的进步,使人们能够在人为控制的条 件下,使用量子点系统研究近藤效应各个方面的性 质1-4],这不仅对这个效应的纯理论研究,而且对 其应用的研究都具有极其重要的意义。由于 Aharonov-Bohm (A-B) 干涉仪是一个标准的探测微观 粒子相干自由度的有力工具,因而目前大多数实验 采用把一个量子点嵌入到 A-B 干涉仪中<sup>[2-3]</sup>,通过 测量该系统的电导随磁通的振动 来研究近藤效应 对电子相干自由度的影响,现在实验上已确定,当电 子通过处于近藤区的量子点时,有 $\pi$ 的相移.在其 中的一些实验中,A-B 干涉仪中半环的长度约为 1µm 这个尺度正好与一些典型金属中的近藤关联 长度  $\xi_{\kappa}$  相当.这些实验工作的成功极大地激发了人 们对于开展研究嵌入单量子点 A-B 环系统的兴 趣5-10].该项研究的主要目的是:1)确定近藤效应 对持续电流的影响 (2) 探测近藤关联长度, 尽管已 经采用了许多不同的近似方法来研究这个点-环系 统,但至今为止,还没有得到一致的理论结果.一

方面:一些理论研究表明,尽管近藤效应对持续电 流有一定影响,但不会导致持续电流的显著增 强<sup>[89]</sup> ;当介观环内平均电子能级间隔 ∂ 大于近藤 温度 T<sup>0</sup> 时,其尺寸效应将减弱近藤效应,并且在 极限下  $\delta >> T_{K}^{0}$ ,近藤效应将消失<sup>[11–13]</sup>.然而,另外 一些理论的研究表明,近藤效应能够导致持续电流 的显著增强<sup>[7]</sup> :在极限  $\delta >> T^0_{\kappa}$  下,尺寸效应不能完 全碎灭近藤效应[7,14,15],这是因为在点-环系统里, 电子为了环绕磁通转动必须通过量子点,另一方面: 一些理论认为这个点-环系统是一个探测近藤屏蔽 云的理想系统<sup>9]</sup> 这是因为当环的周长 *L* 增大为两 倍近藤关联长度  $\xi_{\kappa}$  时,即:  $L = 2\xi_{\kappa}$ ,系统将从一个 没有完全屏蔽的简并态进入到一个完全屏蔽的单 态,这将导致系统的基态性质发生一个大的改变。 通过测量这种性质的变化,就可以达到测量近藤关 联长度的目的,但另外的理论认为这是不可能的, 因为在近藤问题中,自旋自由度和电荷自由度是退 耦的<sup>[12]</sup>.显然,由于尺寸效应和近藤屏蔽效应共存 于这个点-环系统中,使得这个系统具有复杂和丰 富的物理性质,为人们研究这个系统带来了困难.

<sup>\*</sup>四川省应用基础研究基金资助项目(批准号 102GY029-188)和四川省教育厅自然科学研究基金资助项目(批准号 :2003A0780)资助的课题。

在本文中,我们采用了与以往不同的近似方法,重 新研究了这个点-环系统.其主要特点是我们同时考 虑了尺寸效应和近藤屏蔽效应,得到了一些新的 结果.

#### 2. 系统的模型

一个处于近藤区中的点-环系统,其基态性质 由二重简并( $N_{\sigma} = 2$ )的单杂质 Anderson 模型描 述<sup>[468]</sup>.根据 slave-bonson(S-B)技巧,在  $U \rightarrow \infty$ 时 (U是量子点中的电子库仑排斥作用能),哈密顿 为<sup>[1,6]</sup>

$$H = \sum_{m\sigma} \varepsilon_m c^+_{m\sigma} c_{m\sigma} + \sum_{\sigma} \varepsilon_d f^+_{\sigma} f_{\sigma}$$
$$+ \sum_{m\sigma} (t_m c^+_{m\sigma} b^+ f_{\sigma} + \text{H.c})$$
$$+ \lambda (b^+ b + \sum f^+_{\sigma} f_{\sigma} - 1), \qquad (1)$$

 $c_{ms}^{+}(c_{ms})$ 是环中电子的产生(消灭)算子,  $\lambda$  是 Lagrangian 乘子.  $\varepsilon_{d}$  是量子点中的电子能级,以及  $\varepsilon_{m} = -2t\cos\left(\frac{m}{N}\pi\right)$ 和  $t_{m} = \sqrt{\frac{2}{N}} \sin\left(\frac{m}{N}\pi\right)(t_{L} + t_{R}e^{i\phi}(-1)^{m+1})$ 这里, m = 1.2,...N - 1.t和N分别 是介观环内的近邻格点之间的跃迁矩阵元和格点总 数(包括量子点的个数).  $t_{L}(t_{R})$ 是量子点与左(右) 近邻格点位置之间的隧穿矩阵元,而相因子  $\phi$  定义 为 $\phi = 2\pi\Phi/\Phi_{0}$ ,其中,  $\Phi$ 和 $\Phi_{0}(=hc/e)$ 分别是外磁 通和磁通量子.根据 S-B 技巧,量子点中的电子能 级可以表示为  $d^{+} = f_{\sigma}^{+}b$ ,准费米算子  $f_{\sigma}^{+}$ 和 SB 算 子  $b^{+}$ 分别表示的是单占居的和空的量子点态.由 于量子点只能处于单占居态或空态,因此,必须满 足约束条件  $b^{+}b + \sum_{i} f_{\sigma}^{+}f_{\sigma} = 1$ .

采用平均场近似, S-B 算子 b 可以由一个常数  $b_0 = b(t)$ 所取代,这种近似仅适用于描述零温时,量子点中没有电荷涨落,而只存在有自旋涨落时的情况(近藤区),即满足条件<sup>[17]</sup>:0.9 <  $n_f = \sum_{\sigma} f_{\sigma}^{t} < 1$ ,其中, $n_f$ 是量子点中电子的占居数. 根据方程(1)中所选择的规范条件,介观环中的自由电子对自由能的贡献与外磁通  $\phi$  无关,因而在计算持续电流时可以不考虑.而杂质对自由能的贡献

$$F = \frac{N_{\sigma}}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) \ln(\ln G_{f}(\omega^{+})) d\omega$$

+ 
$$\left(\tilde{\varepsilon}_{d} - \varepsilon_{d}\right) \left(\frac{\Delta}{\Delta_{0}} - 1\right)$$
. (2)

式中  $_{f}(\omega)$ 是费米-狄拉克分布函数,而两个重整 化参数分别为  $\tilde{\epsilon}_{d} = \epsilon_{d} + \lambda$  和 $\Delta = b_{0}^{2}\Delta_{0}$ ,其中  $_{r}\Delta_{0} = \pi_{t}(\epsilon_{F})|_{t}(\epsilon_{F})|^{2}$   $_{r}\Delta_{0}$ 是量子点态和环电子态之间耦 合强度,表征了量子点中电子能级的展宽.  $_{p}(\epsilon_{F})$ 和  $_{t}(\epsilon_{F})$ 分别是介观环中费米能级上的电子态密度 和跃迁振幅.如果我们考虑的是系统处在半填充的 情况( $\epsilon_{F}=0$ ),则有  $_{p}(0)=1/\delta = N(2\pi t)$ 和 $|_{t}(0)|^{2}$  $= \frac{2}{N}(t_{L}^{2} + t_{R}^{2} \mp 2t_{L}t_{R}\cos\phi)$ ,这里,负号对应于 N 为 偶数时的情况(我们把含有偶数个电子的介观环系 统称为偶宇称系统),而正号对应于 N 为奇数时的 情况(我们把含有奇数个电子的介观环系统称为奇 宇称系统).  $G_{t}(\omega^{+})$ 是准费米算子  $f_{a}$ 的推迟格林函 数,通过运动方程方法,可以很容易计算出为

$$G_{f}(\omega^{+}) = \left(\omega^{+} - \tilde{\varepsilon}_{d} - \frac{\Delta}{\Delta_{0}}\sum_{m} \frac{|t_{m}|^{2}}{(\omega^{+} - \varepsilon_{m})}\right)^{-1}.$$
(3)

持续电流与自由能的关系为

$$I(\phi, T) = -\frac{e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial \phi} F(\phi, T). \qquad (4)$$

在零温,通过方程2)给出的自由能和方程3) 给出的推迟格林函数,我们能够得到持续电流的表 达式为

$$\mathcal{K}\phi) = \frac{4et_{\rm L}t_{\rm R}\Delta}{\hbar n\Delta_0} \sum_{m\sigma} \frac{\left(-1\right)^{n+1}\sin^2\left(\frac{m}{N}\pi\right)\left(\varepsilon_m - \tilde{\varepsilon}_{\rm d}\right)}{\left(\varepsilon_m - \tilde{\varepsilon}_{\rm d}\right)^2 + \Delta^2} \sin\phi.$$
(5)

两个重整化参数 ε̃。和 △ 分别是近藤共振峰的 位置和宽度.因为,当系统处于其基态时,其系统的 由自由能最低,因而两个重整化参数的取值应满足 这个自由能最低原理.由此,我们可以导出它们的 平均场方程为

$$\frac{\partial F}{\partial \tilde{\epsilon}_{d}} = \frac{\Delta}{\Delta_{0}} \left( 1 + \sum_{m\sigma} \frac{|t_{m}|^{2}}{(\varepsilon_{m} - \tilde{\epsilon}_{d})^{2} + \Delta^{2}} \right) - 1 = 0,$$

$$\frac{\partial F}{\partial \Delta} = (\tilde{\epsilon}_{d} - \varepsilon_{d}) + \sum_{m\sigma} \frac{|t_{m}|^{2}(\varepsilon_{m} - \tilde{\epsilon}_{d})}{(\varepsilon_{m} - \tilde{\epsilon}_{d})^{2} + \Delta^{2}} = 0. (6)$$

$$\text{if $\mathbf{k}$} \\ \text{if $\mathbf{k}$} \\ \ \text{if $\mathbf{k}$} \\ \ \text{if $\mathbf{k}$} \\ \ if $\mathbf{k}$} \\$$

化率 χ<sub>imp</sub>,可先对系统施加一个外磁场 h,然后求 自由能对外磁场的二阶导数,再让外磁场为零,最 后,我们可以求出磁化率为

$$\chi_{imp} = \left(-\frac{\partial^2 F}{\partial h^2}\right)_{h=0}$$
$$= -\left(g\mu_{\beta}\right)^2 \frac{\Delta}{\Delta_0} \sum_{m} \frac{|t_m|^2 (\varepsilon_m - \tilde{\varepsilon}_d)}{\left[(\varepsilon_m - \tilde{\varepsilon}_d)^2 + \Delta^2\right]^2}.(7)$$

一些理论已表明<sup>[8,9]</sup>, 当系统处在近藤区时, 其系统的热力学量是标度变量  $\xi_{\rm K}/L$  或 $\delta/T_{\rm K}^{0}$ 的普适 标度函数,两个标度变量满足  $\delta/T_{\rm K}^{0} = 2\pi\xi_{\rm K}/L$ .所 以,我们在求解方程(7)时,可以选择相因子  $\phi$  和 一个标度变量  $\xi_{\rm K}/L$  作为系统热力学函数的自变量. 我们选取有关的参数为  $\varepsilon_{\rm d} = -0.6$ ,  $t_{\rm L} = t_{\rm R} = 0.25$  和 t = 1,这些参数值可以确保点-环系统处在近藤区, 即,满足条件: $\varepsilon_{\rm d}/\Delta_{0} << -0.5$ .在体极限  $\delta \rightarrow 0$  下 (对应于一个无限大的环),我们计算出相因子  $\phi =$  $0.5\pi$ 时的体近藤温度为  $T_{\rm K}^{0} = 7.8 \times 10^{-4}$ ,体杂质磁 化率为  $\chi_{\rm imp}^{0} = 20\chi g\mu_{\beta}$ ,以及量子点中的体占居数 为  $n_{\rm f}^{0} = 0.9938$ .应该指出的是,由于处在近藤区的 物理系统都表现出标度函数的性质.因此,参数的 选择并不影响物理,而是仅仅改变体极限时特征量  $T_{\rm K}^{0}, \chi_{\rm imp}^{0}, n_{\rm f}^{0}$ .

#### 3. 计算结果及讨论

我们采用数值计算的方法,求解了平均场方程 (7),计算了有关物理量,其计算及讨论如下.

图 1 和图 2 分别展示了在几个不同大小的介观 环中 ,近藤共振峰的能极位置和宽度 △ 随外磁通 ∮ 变化的情况.  $\phi = \pm 0.5\pi$  是两个特殊的对称点, 在 这两点处,由于耦合强度 $\Delta_0$ 中的交叉项 $t_{\rm L}t_{\rm R}$ 消失 了,那么,耦合强度 🛆。在两种宇称系统中有一样 的值,因此,此处近藤共振峰的位置和宽度在大小 不同介观环中的变化完全来自于近藤屏蔽云和尺寸 效应的影响,当介观环的周长小于近藤关联长度时  $(\xi_{\kappa}/L>1)$ ,系统处于一个不完全屏蔽的基态并同 时还存在有尺寸效应(即, $\delta/T_{\kappa}^{0} > 1$ ).从图1和2中, 我们能够看到,尽管不完全屏蔽的基态和尺寸效应 使两种宇称系统中的共振位置都远离费米能级 并 都有一个宽的共振峰和一个弱的近藤关联,但这种 影响的程度在两种宇称系统中是不同的.相对于偶 宇称的点-环系统 我们取偶数个电子对为偶宇称 , 即,电子总数能够被4整除)而言,不完全屏蔽的基 态和尺寸效应使得奇宇称系统(我们取奇数个电子 对再加一个电子为奇宇称)中的共振位置更加远离

费米能级,但有一个较窄的共振峰.当增加介观环 的长度使之大于近藤关联长度( $\xi_{\rm K}/L < 1$ ),并最后 进入到一个完全屏蔽的基态后(即, $\xi_{\rm K}/L < 0.5$ ),两 种宇称系统中的共振位置都迅速地向费米能级靠 近,而其共振峰的宽度也接近了近藤关联能的体极 限值  $T^0_{\rm K}$ ,此时,两种宇称系统中的情况已相差很 小.而一但尺寸效应消失(即, $\xi_{\rm K}/L \approx 0.15$ 或 $\delta/k_{\rm B}T^0_{\rm K}$  $\approx 1$ ),两种宇称系统中的共振位置和宽度基本上等 于体极限( $\xi_{\rm K}/L \rightarrow 0$ )时的值,即,在体极限的情况 下,近藤共振峰位于费米能级,其峰的宽度为 $T^0_{\rm K}$ , 宇称效应消失,这与稀磁合金中的近藤共振是一 样的.



图1 近藤共振峰的能级位置随磁通的变化 (a) N = 偶数;(b) N = 奇数.

当  $\phi \neq \pm 0.5\pi$  时,耦合强度  $\Delta_0$  中有了交叉项  $t_L t_R$ ,因而两种宇称系统中有了不同的耦合强度, 导致点-环系统有了更强的宇称效应.对于偶宇称的 点-环系统,相对于  $\phi = \pm 0.5\pi$  出现的情况,在 $|\phi|$ <0.5π 的区间内,磁通的影响使近藤共振峰向费 米能级靠近,而峰的宽度也减小,这有利于近藤关 联.在体极限下,共振峰位于费米能级之上,处于 0 至  $T_K^0$ 之间;在 $|\phi| > 0.5\pi$ 的区间内,磁通使没有 完全屏蔽环中的近藤共振峰更加远离费米能级并有



图 2 近藤共振峰的宽度随磁通的变化 (a) *N* = 偶数;(b) *N* = 奇数.

一个更宽的共振峰,这不利于近藤关联.但在体极限下,共振峰位于费米能之下,处于0至 –  $T^0_{\kappa}$ 之间,而此时,在两个区间内的共振峰宽度都小 $T^0_{\kappa}$ ,并形成了两个对称的波峰,其峰值分别处于  $\phi = \pm 0.5\pi$ 处.

而在奇宇称的点-环系统中,与 $\phi = \pm 0.5\pi$ 时 出现的情况相比,当 $\phi \neq \pm 0.5\pi$ 时,磁通的影响总 是让一个没有完全屏蔽基态环中的共振位置远离费 米能级,并总是让共振峰变窄.在体极限下,与偶 宇称系统中出现的情况一样,宇称效应消失.但应 该注意的是,当 $\phi \neq \pm 0.5\pi$ 时,磁通的影响使两种 宇称系统中的共振位置在体极限下都不处于费米能 级上,其峰的宽度也小于  $T^0_{\kappa}$ ,这不同于稀磁合金中 的近藤共振.因此,由于近藤屏蔽云,尺寸效应和 磁通的影响共存于点-环系统中,使得这个系统具 有更为复杂和丰富的物理性质.

此外,从图1中,我们还能看到,在体极限下, 两种宇称系统中的共振位置随磁通的变化,实际上 存在一个 π 的位相差,但这并没有实际的物理意 义,因为,如果我们选取另一组宇称系统,即,取 奇数个电子对作为偶宇称和偶数个电子对再加一个 电子为奇宇称,那么,一个反向的 π 的位相差就会 出现,因此,总的效应是这种 π 的位相差在两种宇 称系统中相抵,因此,宇称效应消失.

图 3( a)展示了零场杂质磁化率 χ im 随标度变量  $\varepsilon_x/L$  变化的情况.为了消除不同的宇称系统中有不 同的耦合强度,以减少宇称效应对杂质磁化率的影  $\mathbf{m}$ ,我们选取  $\phi = 0.5\pi$ ,这样,我们就能更好地研 究近藤屏蔽云和尺寸效应对杂质磁化率产生的影 响,从图 3(a)中,我们能看到,当点-环系统处在一 个没有完全屏蔽的简并态时( $\xi_x/L > 1$ ), 尽管没有 完全屏蔽的基态和尺寸效应使近藤共振峰远离费米 能级, 而峰的宽度也远大于 T<sup>0</sup> , 但在两种宇称系统 中,都有一个非零的零场杂质磁化率,这意味着即 使在  $\xi_{\kappa}/L > 1(\delta/T_{\kappa}^{0} > 1)$ 的情况下,系统中仍然有 一个弱的近藤关联,随着环的增大,共振位置将向 费米能级靠近,使得近藤关联逐渐增强,因而杂质 磁化率  $\chi^0_{im}$ 也会逐渐增大,但由于在不同的宇称系 统中,近藤屏蔽云和尺寸效应对近藤共振的影响不 一样,因此,杂质磁化率 $\chi_{im}$ 随环的增大而变化的 情况,在不同的宇称系统中也是不一样的.



图  $\mathfrak{X}$  a) 杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 随变量  $\xi_K/L$  的变化 ;(b)量子点中的 占居数 n, 随变量  $\xi_K/L$  的变化  $\mathfrak{W} \phi = 0.5\pi$ .

在偶宇称的系统中,杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 随标度变 量  $\xi_{K}/L$  的减小而增大,当系统进入到完全屏蔽的 单态时( $\xi_{K}/L = 0.5$ ),杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 达到了体极 限时的值  $\chi_{imp}^{0}$ .在区间  $0.15 < \xi_{K}/L < 0.5$  内,系统虽 然已处于完全屏蔽的基态,但仍存在有尺寸效应 ( $\delta/T_{K}^{0} > 1$ ),使得杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 略大于体极限时 的值  $\chi_{imp}^{0}$ .在  $\xi_{K}/L \approx 0.15$ ( $\delta/T_{K}^{0} \approx 1$ )时,尺寸效应消 失,杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 再次达到了体极限时的值  $\chi_{imp}^{\cup}$ ,系统进入到了体极限时的状态,这与共振位置和宽度变化的情况是一致的。

而在奇宇称的系统中,由于奇数个电子不利于 近藤关联的形成,因而有了较为复杂的情况.在 $\xi_{\kappa}/L$ L = 2处,杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 就达到了体极限时的值  $\chi_{imp}^{0}$ .随着标度变量  $\xi_{\kappa}/L$ 的继续减小,杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 也继续增大,并在系统进入到完全屏蔽的单态 时( $\xi_{\kappa}/L = 0.5$ ),到达了最大值  $1.5\chi_{imp}^{0}$ .而在只有尺 寸效应的区间内( $0.15 < \xi_{\kappa}/L < 0.5$ ),杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 随标度变量  $\xi_{\kappa}/L$ 的继续减小而开始减小,并在 尺寸效应消失时候( $\xi_{\kappa}/L \approx 0.15$ ),到达了最小值  $0.8\chi_{imp}^{0}$ .随后,杂质磁化率  $\chi_{imp}$ 开始增加,并在体极 限下,达到  $\chi_{imp}^{0}$ .

此外,当 $\xi_{\kappa}/L>0.25$ 时,奇宇称系统中的杂质 磁化率 $\chi_{imp}$ 大于偶宇称系统中的杂质磁化率 $\chi_{imp}$ . 这种现象的出现是由于奇宇称系统中的电荷涨落小 于偶宇称系统中的电荷涨落所致,正如图 3(b)所 示.与近藤模型不同,在 Anderson 模型中,即使在 近藤区,也仍然存在一个小的(在百分之十以内)电 荷涨落.因为 $\chi_{imp} \propto n_i^2 (1 - n_i)^{11}$ ,因此,一个较大 的杂质占居数意味着一个较大的杂质磁化率 $\chi_{imp}$ . 与偶宇称系统相比,奇宇称系统中的共振位置更远 离费米能级,但有一个较窄的共振峰,这有利于压 制奇宇称系统中形成一个局域矩.这与一般的介观系 统不同<sup>[11]</sup>,在那里,奇电子数的系统是不利于一个 局域矩的形成,这说明了两个介观系统具有完全不 同的物理性质.

从图  $\chi$  b )中 ,我们同样可以注意到 ,随着标度 变量  $\xi_{\rm K}/L$  的减小 ,两种宇称系统中的杂质占居数 持续稳定地增加 ,最后 ,在尺寸效应消失( $\xi_{\rm K}/L \approx$ 0.15 )的时侯 ,其值达到体极限值  $n_{\rm f}^0$ .与这种情况形 成对比的是 ,杂质磁化率  $\chi_{\rm imp}$ 分别在完全屏蔽单态 的形成和尺寸效应消失之处 ,有一个大的变化 .特 别是在奇宇称系统中 ,一个波峰在  $\xi_{\rm K}/L = 0.5$  处和 一个波谷在  $\xi_{\rm K}/L = 0.15$  处的出现 .这完全说明杂质 磁化率  $\chi_{\rm imp}$ 的这种变化完全是由于近藤屏蔽云和尺 寸效应的影响所致 .因此 ,我们能够通过实验测定 杂质磁化率  $\chi_{\rm imp}$ 的这种变化 ,从而达到探测近藤屏 蔽云的目的.这同时也说明,近藤屏蔽云和尺寸效 应对杂质占居数没有直接的影响,影响杂质占居数 的是近藤共振峰的位置和宽度,一个远离费米能级 并有一个宽峰的共振有利于电荷的涨落,但不利于 近藤关联,这正是我们已经知道的情况.

图 4 给出了在几个不同大小的介观环中,持续 电流随磁通的变化情况,从图中,我们能看到,近 藤屏蔽云和尺寸效应同样对持续电流有较大的影 响,并导致电流线型的改变.在 $\xi_{\kappa}/L = 16$ 的环中, 由于在两种宇称系统中的共振位置都远离费米能 级 因而 ,只有费米能级上的电子才对持续电流有 明显的贡献,而其它能态是不重要的,所以,没有 宇称效应 , 持续电流随磁通的变化在两种宇称系统 中都呈现出一个正弦函数的线型.随着环的增大, 系统进入到了一个完全屏蔽的单态( $\xi_{\kappa}/L \leq 0.5$ ).此 时,不仅宇称效应出现了,而且,电流的线型也从 正弦型转变到了锯齿型,在偶宇称系统中,锯齿型 出现在  $\xi_{\kappa}/L \approx 0.5$  附近,周期为  $2\pi$ ,电流的峰值也 从  $\xi_{\kappa}/L = 16$  时的  $I_0(=eV_{\kappa}/L$  , 是不含杂质的理想 环中的持续电流峰值)增加到此时的 2.710. 而在奇 宇称系统中,锯齿型出现在  $\xi_{\kappa}/L \approx 0.3$  附近,周期 为  $\pi$ ,其电流的峰值从  $\xi_{\kappa}/L = 16$  时的 0.5 $I_0$  增加到 此时的 0.71。. 电流线型的转变和峰值的增加是因为 当系统进入到了一个完全屏蔽的单态后,共振位置 已靠近了费米能级,使其费米能级附近的其它能态 也对持续电流有了显著的贡献,因为,不同能态上 的电子有不同的相位 ,但它们对持续电流的贡献一 定是相干的 , 而不同能态上电流的相干迭加必定造 成电流线型和电流峰值的改变.因此,锯齿型持续电 流的出现标志着系统进入到了一个完全屏蔽的单态.

如果我们进一步增大介观环的周长,以至于使 系统中的尺寸效应消失了( $\xi_{\kappa}/L \leq 0.15$ 或 $\delta/T_{\kappa}^{0} \leq$ 1),那么,此时的持续电流线型将出现第二次转 变,从 $\xi_{\kappa}/L \approx 0.5$ 时的锯齿型变到了 $\xi_{\kappa}/L \approx 0.15$ 时 的准-Fano 线型.这里,我们把第三种线型称为准-Fano 线型,这是因为它看上去非常类似于凝聚态物 理中的 Fano 线型<sup>[18]</sup>.所以,我们可以说准-Fano 线 型持续电流的出现意味着系统中的尺寸效应消失 了.实事上,从前面我们对近藤共振峰的位置和宽 度以及对杂质磁化率的讨论中,我们已经看到,当 系统中的尺寸效应消失的时候,其系统基本开始进 入到了一个体极限时的状态.此时,共振位置位于 费米能级附近,费米能级处的电子态密度也增大,



图 4 持续电流 / 随磁通 ∮ 的变化 (a) 偶宇称系统 ;(b) 奇宇 称系统.

在杂质处能够形成一个正常的近藤共振,使得更多的能态对持续电流有贡献,导致准-Fano 线型持续电流的出现.从图中,我们同样可以注意到,在体极限下( $\xi_{\kappa}/L \rightarrow 0$ ),持续电流保持准-Fano 线型不变,仅仅是电流的峰值要改变.在偶宇称系统中,电流峰值从最大时的 2.7 $I_0$  下降到了体极限时的 2 $I_0$ ;而在奇宇称系统中,电流峰值在体极限下趋于零.

这种奇宇称系统中电流峰值在体极限下受到极 大减弱的现象可以由 Leggett 定理给予解释. 根据 Leggett 定理:介观 *A-B* 环中持续电流的方向不是由 环中的总电子数决定,而是由给定自旋的电子数  $N_e^r$ 所决定<sup>[8]</sup>.对于偶宇称的系统,自旋向上的电子 总数总是与自旋向下的电子总数相等(即, $N_e^{\dagger} = N_e^{\dagger}$ ),因此,两种自旋方向的电子产生的持续电流 有相同的方向,导致电流相加的增强现象.而在奇 宇称系统中,自旋向上的电子总数总是与自旋向下 的电子总数相差一个电子(即, $N_e^{\dagger} = N_e^{\dagger} \pm 1$ ),导致 两种自旋方向的电子产生的持续电流有相反的方 向,因此,要相互抵消.这也是为什么奇宇称系统 中的持续电流峰值总是要远小于偶宇称系统中的持 续电流峰值的主要原因.

我们计算的结果与文献[9]的结果部份一致, 但差异是非常清楚的,最大的不同是在我们的计算 中,持续电流的线型发生了两次转变,即,当系统 进入到一个完全屏蔽的单态时,出现了锯齿型的持 续电流 : 而当系统中的尺寸效应消失时 , 出现了准-Fano 线型的持续电流. 应该提请注意的是,这种近 藤屏蔽云和尺寸效应对持续电流产生大的影响,与 这两种效应对近藤共振峰的位置和宽度,以及对杂 质磁化率有大的影响是完全一致的,而在文献 9 的 结果中,持续电流仅经历过一次线型的转变,即, 从  $\xi_{\kappa}/L \gg 1$  时的正弦型持续电流转变到了  $\xi_{\kappa}/L \ll 1$ 时的锯齿型持续电流,其持续电流线型的转变与变 分近似的结果正相反<sup>[8]</sup>,在那里,从 $\xi_{\kappa}/L \gg 1$ 时的 锯齿型持续电流转变到了  $\xi_{\kappa}/L \ll 1$  时的正弦型持续 电流,这些情形有点类似于一个不含杂质的理想介 观环中的持续电流,这表明,我们的计算比文献91 采用的近似和变分近似更细一些,因而,反映出来 的物理现象也要多一些.

此外,在一个理想介观环中,单个能态对持续 电流的贡献是一个标准的简谐函数,而许多简谐函 数之和必是一个锯齿型函数,在文献 9 的计算中, 所采用的哈密顿具有粒子-空穴对称性,环中电子 与杂质之间仅存在反铁磁交换作用,当系统进入到 体极限的状态时,一个正常的近藤共振形成,使每 个能态对持续电流的贡献都是一个标准的简谐函 数,而许多简谐函数之和是一个锯齿型函数.因 此,总的持续电流具有锯齿型是一个自然的结果. 而在我们的计算中,所采用的哈密顿没有粒子-空 穴对称性,此时,环中电子除了受到杂质的反铁磁 交换作用以外,还要受到一个纯势的散射13,使得 每个能态对持续电流的贡献并不是一个标准的简谐 函数,而是有一个偏离.如图3.5所示,当 $\xi_{\kappa}/L \approx$ 16时,持续电流仅来自费米能级的贡献。从图中, 我们能够看到 , 持续电流的线型与标准的简谐函数 有一个小的偏差,我们可以称之为准-简谐型函数. 这样,当 $\xi_{\kappa}/L \approx 0.5$ 时,可数个的准-简谐型函数的 相加导致了锯齿型持续电流的出现;而当 $\xi_{
m K}/Lpprox$ 0.15 时, 许多准-简谐型函数的相加导致了准-Fano 线型持续电流的出现,因此,我们可以通过测量持 续电流的线型随介观环空间尺度的变化而转变的情 况,达到探测近藤屏蔽云的目的.

#### 4. 结 论

在本文中,我们使用单杂质的 Ansderson 模型, 研究了一个嵌入单量子点介观 A-B 环系统处在近 藤区时的基态性质,并用 slave-boson 平均场方法求 解了哈密顿.我们的结果表明,在零温,当介观环 内电子平均能级间隔远大于近藤关联能时,在两种

- 宇称系统中,都有一个非零的零场杂质磁化率,这 意味着系统中仍然存在有一个弱的近藤关联<sup>11</sup>;系 统的基态性质衣赖于系统的宇称和介观环的大小; 尺寸效应和近藤屏蔽效应的共存导致了系统丰富的 物理性质;当系统进入到一个完全屏蔽的单态和系 统中尺寸效应消失的时候,杂质磁化率和持续电流 的线型及峰值都发生了大的变化.因此,可以通过 测量这种变化,达到探测近藤屏蔽云的目的.
- [1] Hewson A C 1993 The Kondo Problem to Heavy Fermions (Cambridge: Cambridge University Press) Yie J F et al 2003 Acta Phys. Sin. 52 468 (in Chinese)[叶剑斐 等 2003 物理学报 52 468] Goldhaber-Gordon D et al 1998 Nature 391 156

Cronenwett S M et al 1998 Science 281 540

- Wu S Q et al 2004 Acta Phys. Sin. 53 2336(in Chinese ] 吴绍全 等 2004 物理学报 53 2336]
- [2] Van der Wiel W G et al 2000 Science 289 2105
   Yacoby A et al 1995 Phys. Rev. Lett. 74 4047
   Ji Yang et al 2002 Phys. Rev. Lett. 88 076601
   Aikawa H et al 2004 Phys. Rev. Lett. 92 176802
- [3] Schuster R et al 1997 Nature 385 417
   Yang J et al 2000 Science 290 770
- [4] Ng T K and Lee L A 1988 Phys. Rev. Lett. 61 1768
   Glazmon L I and Raikh M E 1988 JEPT Lett. 47 452
   Meir Y et al 1993 Phys. Rev. Lett. 70 2601
- Zvyagin A A and Bandos T V 1994 Low Tem. Phys. 20 222
   Zvyagin A A and Bandos T V 1995 Low Tem. Phys. 21 349
- [6] Büttiker N and Stafford C A 1996 Phys. Rev. Lett. 76 495
   Wang Zh Q 2002 Acta Phys. Sin. 51 1808 (in Chinese)[汪仲清 2002 物理学报 51 1808]
- [7] Ferrari V et al 1999 Phys. Rev. Lett. 82 5088

Ji Y H et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 395 (in Chinese)[ 嵇英华 等 2002 物理学报 51 395].

- [8] Kang K and Shin S C 2000 *Phys*. *Rev*. *Lett*. **85** 5619 Long Ch Y 2002 *Acta Phys*. *Sin*. **51** 159(in Chinese)[龙超云等 2002 物理学报 **51** 159]
- [9] Affleck I and Simon P 2001 Phys. Rev. Lett. 86 2854
   Simon P and Affleck I 2001 Phys. Rev. B 64 085308
   Hu H et al 2001 Phys. Rev. Lett. 86 5558
- [10] Aligia A A 2002 cond-mat/0206528
   Wang T H 2001 Acta Phys. Sin. 10 844 ( in Chinese ) [王太宏等 Chin. Phys. 10 844 ]
- [11] Thimm W B et al 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2143
- [12] Zvyagin A A 2001 Phys. Rev. Lett. 87 179704
   Zvyagin A A 2002 cond-mat/0203253
- [13] Eckle H P et al 2001 Phys. Rev. Lett. 87 016602
- [14] Anda E V et al 2001 cond-mat/0106055
- [15] Schlottmann P 2001 Phys. Rev. B 65 024420
- [16] Coleman P 1987 Phys. Rev. B 35 5072
   Bickers N E 1987 Rev. Mod. Phys. 59 845
   Newns D M and Read N 1988 Adv. Phys. 36 799
- [17] Costi T A, Hewson A C and Zlatic V 1994 J. Phys : Condens. Matter 6 2519
- [18] Fano U 1961 Phys. Rve. 124 1866

## Kondo effect in the quantum dot embedded in the Aharonov-Bohm ring \*

Wu Shao-Quan<sup>1)†</sup> Sun Wei-Li<sup>1)</sup> Yu Wan-Lun<sup>2)</sup> Wang Shun-Jin<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> (Department of Physics , Sichuan Normal University , Chengdu 610068 , China )

 $^{2}$  ( Chengdu University of Information and Technology , Chengdu 610030 , China )

<sup>3</sup> ( Department of Physics , Sichuan University , Chengdu 610034 , China )

(Received 6 August 2004; revised manuscript received 8 November 2004)

#### Abstract

The properties of the ground state of a closed dot-ring system with a magnetic flux in the Kondo regime are studied theoretically by means of a one-impurity Anderson Hamiltonian. The Hamiltonian is solved by means of the Slave-Boson mean-field theory. It is shown that at T = 0, a suppressed Kondo effect exists in this system even when the mean level spacing of electrons in the ring is larger than the bulk Kondo temperature ; the physical quantities of this system depend sensitively on both the parity of the system and the size of the ring ; the rich physical behaviors of this system can attribute to the coexistence of both the finite-size effect and the Kondo screening effect in this system. It is also possible to detect the Kondo screening cloud by measuring the persistent current or the zero-field impurity susceptibility  $\chi_{imp}$  directly in future experiments.

Keywords : persistent current , impurity susceptibility , parity effect , Kondo effect , Kondo screening cloud PACC : 7335 , 7335C , 7215Q

<sup>\*</sup> Project supported by the Funds for Major Basic Research Project of Sichuan Province, China(Grant No. 02GY029-188), and the Natural Science Foundation of the Committee of Education of Sichuan Province, China(Grant No. 2003A0780).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Corresponding author. E-mail : sqwucd@yahoo.com.cn